# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-332929

(43)Date of publication of application: 18.12.1998

(51)Int.CI.

G02B 5/20 C09D 5/00 G03F 7/004 G03F 7/033

(21)Application number: 09-153134

(71)Applicant: JSR CORP

(22)Date of filing:

28.05.1997

(72)Inventor: ITANO TAKASHI

ABE SHIGERU NEMOTO HIROAKI KUMANO KOJI

# (54) RADIATION-SENSITIVE COMPOSITION FOR COLOR FILTER

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To form a pixel array with high accuracy and excellent adhesion strength to a substrate in high yield without leaving an unsolved compsn. in the region not irradiated with radiation or without producing scum on pixels by incorporating a coloring agent, a binder polymer, carboxyl group-contg. polyfunctional monomers and a photopolymn. initiator. SOLUTION: This compsn. contains a coloring agent, a binder polymer, carboxyl group-contg. polyfunctional monomers, and a photopolymn, initiator. As for the binder polymer, any polymers can be used as far as they act as a binder for the coloring agent and are soluble with an alkali developer used in the developing process in the production of the color filter. The carboxyl groupcontg. polyfunctional monomers have two or more polymerizable ethylene- type unsatd, bonds. The photopolymn. initiator is a compd. which decomposes or cleaves the bonding groups by irradiation of light and produces radicals which can initiate polymn, of the carboxyl group-contg. polyfunctional monomers.

$$\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{OCOCH} = \text{CH}_2 \\ \text{CH}_2 = \text{CHCOD} - \text{CH}_2 - \text{C} - \text{CH}_2 - \text{OCOCH}_2 \text{CH}_2 \\ \text{CH}_2 = \text{CHCOD} + \text{CH}_2 \\ \text{CH}_2 = \text{CHCOD} + \text{CH}_2 \end{array}$$

### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平10-332929

(43)公開日 平成10年(1998)12月18日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	FΙ				
G02B 5	5/20	101	G 0 2 B	5/20	101		
C09D 5	5/00		C 0 9 D	5/00	С		
	7/004	5 0 5	G03F	7/004	505		
	7/033			7/033			
			審査請求	未請求	請求項の数 1	FD (	全 12 頁)
(21)出願番号		特願平9-153134	(71)出願人	000004178			
				ジェイン	エスアール株式会	<b>会社</b>	
(22)出願日		平成9年(1997)5月28日		東京都中	中央区築地2丁目	目11番24号	
			(72)発明者	板野 ≉	<b>岑</b> 史		
				東京都中	中央区築地二丁目	11番24号	日本合
				成ゴムを	朱式会社内		
			(72)発明者	阿部	慈		
				東京都中	中央区築地二丁目	311番24号	日本合
				成ゴム	朱式会社内		
			(72)発明者	根本	宏明		
				東京都中	中央区築地二丁目	目11番24号	日本合
				成ゴム	朱式会社内		
			(74)代理人	弁理士	福沢 俊明		
					最終頁に続く		

## (54) 【発明の名称】 カラーフィルタ用感放射線性組成物

# (57)【要約】

【課題】 微細な画素アレイを形成する場合であっても、放射線非照射部に組成物の未溶解物(残渣)が残存したり、画素上にスカムが発生することがなく、しかも高精度でかつ基板との密着強度に優れた画素アレイを高い歩留りで形成することができるカラーフィルタ用感放射線性組成物を提供する。

【解決手段】 カラーフィルタ用感放射線性組成物は、(A)着色剤、(B)バインダーポリマー、(C)カルボキシル基含有多官能性モノマーおよび(D)光重合開始剤を含有することを特徴とする。

10

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 着色剤、(B) バインダーポリマー、(C) カルボキシル基含有多官能性モノマーおよび(D) 光重合開始剤を含有することを特徴とするカラーフィルタ用感放射線性組成物。

#### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、カラー液晶表示装置、カラー撮像管素子等に用いられるカラーフィルタの製造に使用されるカラーフィルタ用感放射線性組成物に関する。

#### [0002]

【従来の技術】カラー液晶表示装置、カラー撮像管素子 等に用いられるカラーフィルタを形成するには感放射線 性組成物が使用されており、かかる組成物としては、高 感度、基板との密着性、耐薬品性等が要求されるため、 一般にネガ型の感放射線性組成物が用いられている。こ のようなネガ型感放射線性組成物を用いてカラーフィル タを形成する際には、通常、透明基板上にパターン形状 の遮光層を形成して、着色剤を分散したネガ型感放射線 性組成物樹脂を基板上に塗布し、フォトマスクを介して 放射線を照射したのち、現像して、放射線非照射部を現 像液で溶解することにより、画素パターンを形成してお り、前記着色剤としては、赤、緑および青の3原色が使 用されている。前記着色剤を分散したネガ型感放射線性 組成物には、従来、(メタ)アクリル酸等の酸性官能基 を含有する樹脂、ペンタエリスリトールトリ(メタ)ア クリレート等の多官能性モノマーおよび1-ヒドロキシ シクロヘキシルフェニルケトン等の光重合開始剤を含む ものが主に用いられている。しかしながら、このような ネガ型感放射線性組成物からカラーフィルタを形成しよ うとすると、アルカリ現像液を用いて現像する際に、放 射線の照射により硬化した画素部分がアルカリ現像液に より膨潤し、得られる画素パターンの分解能が低下した り、画素パターンが変形することがあった。特に、着色 剤を分散したネガ型感放射線性組成物を、例えば撮像管 素子などのようにシリコーンウエハー上に微細な画素ア レイを形成するような電子工学的用途に用いると、アル カリ現像液により現像する場合に、得られた画素パター ン上にスカム(浮きかす)が発生したり、表面荒れを生 じたり、画素アレイの一部が脱落するなどの問題点があ り、高精度の画素アレイを高い歩留りで製造することが 困難であった。また、画素パターンの密着強度が現像に より低下してしまい、画素アレイの形成後に配向膜や透 明導電膜を設ける際に、画素パターンが基板から剥離す るという欠点もあった。このような問題点を解決するも のとして、例えば赤色顔料、ポリビニルフェノール、メ チロール化メラミンおよび1,1-ビス(p-クロロフ エニル)-2,2,2ートリクロロエタン等の光酸発生 剤からなる化学増幅型のネガ型感放射線性組成物も提案 されており、該組成物を用いて得られたカラーフィルタは、微細な画素パターンであっても充分な密着強度を有している。しかしながら、この化学増幅型ネガ型感放射線性組成物を用いて微細な画素アレイを形成しようとすると、アルカリ現像液で現像する際に、放射線非照射部(非画素部)に、組成物の未溶解物(残渣)が残存したり、画素上にスカムが発生することがあった。そのため、微細な画素アレイを形成する場合であっても、放射線非照射部に組成物の未溶解物(残渣)が残存したり、画素上にスカムが発生することがなく、高精度でかつ基板との密着強度に優れた画素アレイを形成しうるネガ型のカラーフィルタ用感放射線性組成物の開発が望まれていた。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、以上のような事情に鑑みてなされたものであり、その課題は、微細な画素アレイを形成する場合であっても、放射線非照射部に組成物の未溶解物(残渣)が残存したり、画素上にスカムが発生することがなく、しかも高精度でかつ基板との密着強度に優れた画素アレイを高い歩留りで形成することができるカラーフィルタ用感放射線性組成物を提供することにある。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明の要旨は、(A) 着色剤、(B) バインダーポリマー、(C) カルボキシル基含有多官能性モノマーおよび(D) 光重合開始剤を含有することを特徴とするカラーフィルタ用感放射線性組成物、からなる。

【0005】以下、本発明を詳細に説明する。

### 0 (A) 着色剤

本発明における着色剤は、色調が特に限定されるもので はなく、カラーフィルタの用途に応じて適宜選定され、 また有機着色剤でも無機着色剤でもよい。前記有機着色 剤としては、染料、有機顔料、天然色素等を挙げること ができ、また前記無機着色剤としては、無機顔料のほ か、体質顔料と呼ばれる無機塩等を挙げることができる が、カラーフィルタには高精密な発色と耐熱性が求めら れることから、本発明における着色剤としては、発色性 が高く、かつ耐熱性の高い着色剤、特に耐熱分解性の高 い着色剤が好ましく、通常有機着色剤が使用され、特に 有機顔料が好ましい。前記有機顔料としては、例えば、 カラーインデックス (C. I.; The Society of Dyers and Colourists 社発行) において、ピグメント (Pigment) に分類されている化合物、具体的には、下記するカラー インデックス番号が付されているものを挙げることがで きる。C. I. ピグメントエロー12、C. I. ピグメントエロ -13、C.I. ピグメントエロー14、C.I. ピグメントエ ロー17、C. I. ピグメントエロー20、C. I. ピグメント エロー24、C. I. ピグメントエロー31、C. I. ピグメン トエロー55、C. I. ピグメントエロー83、C. I. ピグメ

ントエロー93、C. I. ピグメントエロー109、C. I. ピ グメントエロー110、C.I. ピグメントエロー139、 C. I. ピグメントエロー150、C. I. ピグメントエロー1 53、C. I. ピグメントエロー154、C. I. ピグメントエ ロー166、C. I. ピグメントエロー168; C. I. ピグメ ントオレンジ36、C.I.ピグメントオレンジ43、C.I. ピグメントオレンジ51; C. I. ピグメントレッド9、C. I. ピグメントレッド97、C. I. ピグメントレッド12 2、C. I. ピグメントレッド123、C. I. ピグメントレッ ド149、C. I. ピグメントレッド176、C. I. ピグメン トレッド177、C.I. ピグメントレッド180、C.I. ピ グメントレッド215:C.I.ピグメントバイオレット1 9、ピグメントバイオレット23、ピグメントバイオレ ット29;C.I.ピグメントブルー15、C.I.ピグメント ブルー15:3、C.I. ピグメントブルー15:6;C.I. ピグメントグリーン7、C. I. ピグメントグリーン36; C. I. ピグメントブラウン23、C. I. ピグメントブラウン 25; C. I. ピグメントブラック1、ピグメントブラック 7 .

【0006】また、前記無機着色剤の具体例としては、酸化チタン、硫酸バリウム、亜鉛華、硫酸鉛、黄色鉛、亜鉛黄、ベんがら(赤色酸化鉄(III))、カドミウム赤、群青、紺青、酸化クロム緑、コバルト緑、アンバー、チタンブラック、合成鉄黒、カーボンブラック等を挙げることができる。これらの着色剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。

### 【0007】(B) バインダーポリマー

本発明におけるバインダーポリマーとしては、着色剤に 対してバインダーとして作用し、かつカラーフィルタ製 造時の現像処理工程において用いられるアルカリ現像液 に可溶性である限り、適宜のポリマーを使用することが できる。このようなバインダーポリマーとしては、例え ば、カルボキシル基、フェノール性水酸基等の酸性官能 基を含有するポリマーを挙げることができる。本発明に おけるバインダーポリマーとしては、カルボキシル基を 含有するポリマーが好ましく、特に、1個以上のカルボ キシル基を含有するエチレン性不飽和モノマー(以下、 単に「カルボキシル基含有不飽和モノマー」という。) と、他の共重合可能なエチレン性不飽和モノマー(以 下、単に「他の不飽和モノマー」という。) との共重合 40 体(以下、単に「カルボキシル基含有共重合体」とい う。)が好ましい。前記カルボキシル基含有不飽和モノ マーとしては、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、ク ロトン酸、αークロルアクリル酸、エタクリル酸、けい 皮酸等の不飽和モノカルボン酸類:マレイン酸、無水マ レイン酸、フマル酸、イタコン酸、無水イタコン酸、シ トラコン酸、無水シトラコン酸、メサコン酸等の不飽和 ジカルボン酸(無水物)類;3価以上の不飽和多価カル ボン酸(無水物)類等を挙げることができる。これらの カルボキシル基含有不飽和モノマーは、単独でまたは2

種以上を混合して使用することができる。

【0008】また、前記他の不飽和モノマーとしては、 例えば、スチレン、α-メチルスチレン、o-ビニルト ルエン、mービニルトルエン、pービニルトルエン、o -クロルスチレン、m-クロルスチレン、p-クロルス チレン、o-メトキシスチレン、m-メトキシスチレ ン、p-メトキシスチレン、p-ビニルベンジルメチル エーテル、pービニルベンジルグリシジルエーテル等の 芳香族ビニル化合物:メチルアクリレート、メチルメタ クリレート、エチルアクリレート、エチルメタクリレー ト、nープロピルアクリレート、iープロピルアクリレ ート、nープロピルメタクリレート、iープロピルメタ クリレート、nーブチルアクリレート、iーブチルアク リレート、sec-ブチルアクリレート、t-ブチルア クリレート、n-ブチルメタクリレート、i-ブチルメ タクリレート、secーブチルメタクリレート、tーブ チルメタクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレー ト、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、2-ヒドロ キシプロピルアクリレート、2-ヒドロキシプロピルメ 20 タクリレート、2-ヒドロキシブチルアクリレート、2 ヒドロキシブチルメタクリレート、アリルアクリレー ト、アリルメタクリレート、ベンジルアクリレート、ベ ンジルメタクリレート、2-アクリロイロキシエチルこ はく酸(商品名M-5300)、2-メタクリロイロキ シエチルこはく酸、メトキシトリエチレングリコールア クリレート(商品名MTG-A)、メトキシトリエチレ ングリコールメタクリレート等の不飽和カルボン酸エス テル類;2-アミノエチルアクリレート、2-アミノエ チルメタクリレート、2-アミノプロピルアクリレー ト、2-アミノプロピルメタクリレート等の不飽和カル ボン酸アミノアルキルエステル類;グリシジルアクリレ ート、グリシジルメタクリレート等の不飽和カルボン酸 グリシジルエステル類;酢酸ビニル、プロピオン酸ビニ ル、酪酸ビニル、安息香酸ビニル等のカルボン酸ビニル エステル類;ビニルメチルエーテル、ビニルエチルエー テル、アリルグリシジルエーテル、メタリルグリシジル エーテル等の不飽和エーテル類;アクリロニトリル、メ タクリロニトリル、 $\alpha$  - クロロアクリロニトリル、シア ン化ビニリデン等のシアン化ビニル化合物:アクリルア ミド、メタクリルアミド、α-クロロアクリルアミド、 N-(2-ヒドロキシエチル)アクリルアミド、N-(2-ヒドロキシエチル)メタクリルアミド、マレイミ ド、N-フェニルマレイミド、N-シクロヘキシルマレ イミド等の不飽和アミドあるいは不飽和イミド類; 1, 3-ブタジエン、イソプレン、クロロプレン等の脂肪族 共役ジエン類;ポリスチレン、ポリメチルアクリレー ト、ポリメチルメタクリレート、ポリnーブチルアクリ レート、ポリnーブチルメタクリレート、ポリシロキサ ン等の重合体分子鎖の末端にモノアクリロイル基あるい はモノメタクリロイル基を有するマクロモノマー類等を

挙げることができる。これらの他の不飽和モノマーは、 単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。

【0009】カルボキシル基含有共重合体におけるカル ボキシル基含有不飽和モノマーの共重合割合は、通常、 5~50重量%、好ましくは10~40重量%である。 この場合、カルボキシル基含有不飽和モノマーの共重合 割合が5重量%未満では、得られる感放射線性組成物の アルカリ現像液に対する溶解性が低下する傾向があり、 また50重量%を超えると、アルカリ現像液による現像 時に、形成された画素パターンが基板から脱落したり、 画素表面の膜荒れを来たしやすくなる傾向がある。特に カルボキシル基含有不飽和モノマーを前記特定の共重合 割合で含有するカルボキシル基含有共重合体は、アルカ リ現像液に対して優れた溶解性を有するものであり、当 該共重合体をバインダーとして用いた感放射線性組成物 は、アルカリ現像液による現像後に未溶解物が残存する ことが極めて少なく、基板上の画素を形成する部分以外 の領域における地汚れ、膜残り等が発生し難く、しかも 該組成物から得られる画素パターンは、アルカリ現像液 に過剰に溶解することがなく、基板に対して、優れた密 着性を有し、基板から脱落するおそれもないものとな る。

【0010】本発明におけるカルボキシル基含有共重合 体としては、**①**アクリル酸および/またはメタクリル酸 と②メチルメタクリレート、2-ヒドロキシエチルアク リレート、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、ベン ジルアクリレート、ベンジルメタクリレート、スチレ ン、ポリスチレンマクロモノマーおよびポリメチルメタ クリレートマクロモノマーの群から選ばれる少なくとも 1種との共重合体(以下、「カルボキシル基含有共重合 体(b)」という。)が好ましい。好ましいカルボキシ ル基含有共重合体(b)の具体例としては、アクリル酸 /ベンジルアクリレート共重合体、アクリル酸/ベンジ ルアクリレート/スチレン共重合体、アクリル酸/メチ ルアクリレート/スチレン共重合体、アクリル酸/ベン ジルアクリレート/ポリスチレンマクロモノマー共重合 体、アクリル酸/ベンジルアクリレート/ポリメチルメ タクリレートマクロモノマー共重合体、アクリル酸/メ チルアクリレート/ポリスチレンマクロモノマー共重合 体、アクリル酸/メチルアクリレート/ポリメチルメタ クリレートマクロモノマー共重合体、アクリル酸/ベン ジルメタクリレート共重合体、アクリル酸/ベンジルメ タクリレート/スチレン共重合体、アクリル酸/メチル メタクリレート/スチレン共重合体、アクリル酸/ベン ジルメタクリレート/ポリスチレンマクロモノマー共重 合体、アクリル酸/ベンジルメタクリレート/ポリメチ ルメタクリレートマクロモノマー共重合体、アクリル酸 /メチルメタクリレート/ポリスチレンマクロモノマー 共重合体、アクリル酸/メチルメタクリレート/ポリメ

チルメタクリレートマクロモノマー共重合体、アクリル酸/2-ヒドロキシエチルメタクリレート/ベンジルメタクリレート/ポリスチレンマクロモノマー共重合体、アクリル酸/2-ヒドロキシエチルメタクリレート/ベンジルメタクリレート/ポリメチルメタクリレートマクロモノマー共重合体、

【0011】メタクリル酸/ベンジルアクリレート共重 合体、メタクリル酸/ベンジルアクリレート/スチレン 共重合体、メタクリル酸/メチルアクリレート/スチレ ン共重合体、メタクリル酸/ベンジルアクリレート/ポ リスチレンマクロモノマー共重合体、メタクリル酸/ベ ンジルアクリレート/ポリメチルメタクリレートマクロ モノマー共重合体、メタクリル酸/メチルアクリレート /ポリスチレンマクロモノマー共重合体、メタクリル酸 /メチルアクリレート/ポリメチルメタクリレートマク ロモノマー共重合体、メタクリル酸/ベンジルメタクリ レート共重合体、メタクリル酸/ベンジルメタクリレー ト/スチレン共重合体、メタクリル酸/メチルメタクリ レート/スチレン共重合体、メタクリル酸/ベンジルメ タクリレート/ポリスチレンマクロモノマー共重合体、 メタクリル酸/ベンジルメタクリレート/ポリメチルメ タクリレートマクロモノマー共重合体、メタクリル酸/ メチルメタクリレート/ポリスチレンマクロモノマー共 重合体、メタクリル酸/メチルメタクリレート/ポリメ チルメタクリレートマクロモノマー共重合体、メタクリ ル酸/2-ヒドロキシエチルメタクリレート/ベンジル メタクリレート/ポリスチレンマクロモノマー共重合 体、メタクリル酸/2-ヒドロキシエチルメタクリレー ト/ベンジルメタクリレート/ポリメチルメタクリレー トマクロモノマー共重合体等を挙げることができる。

【0012】これらのカルボキシル基含有共重合体 (b) のうち、特に、メタクリル酸/ベンジルメタクリ レート共重合体、メタクリル酸/ベンジルメタクリレー ト/スチレン共重合体、メタクリル酸/メチルメタクリ レート/スチレン共重合体、メタクリル酸/ベンジルメ タクリレート/ポリスチレンマクロモノマー共重合体、 メタクリル酸/ベンジルメタクリレート/ポリメチルメ タクリレートマクロモノマー共重合体、メタクリル酸/ メチルメタクリレート/ポリスチレンマクロモノマー共 重合体、メタクリル酸/メチルメタクリレート/ポリメ チルメタクリレートマクロモノマー共重合体、メタクリ ル酸/2-ヒドロキシエチルメタクリレート/ベンジル メタクリレート/ポリスチレンマクロモノマー共重合 体、メタクリル酸/2-ヒドロキシエチルメタクリレー ト/ベンジルメタクリレート/ポリメチルメタクリレー トマクロモノマー共重合体が好ましい。前記カルボキシ ル基含有共重合体(b)は、単独でまたは2種以上を混 合して使用することができ、また場合により、1種以上 の他のバインダーポリマーと併用することもできる。

【0013】バインダーポリマーのゲルパーミエーショ

20

ンクロマトグラフィー (GPC; 溶出溶媒テトラヒドロ フラン) で測定したポリスチレン換算重量平均分子量 (以下、単に「重量平均分子量」という。) は、好まし くは3,000~300,000、さらに好ましくは 5,000~100,000である。このような特定の 重量平均分子量を有するバインダーポリマーを使用する ことにより、現像性に優れた感放射線性組成物が得ら れ、それによりシャープなパターンエッジを有する画素 アレイを形成することができるとともに、現像処理時に 基板上の画素を形成する部分以外の領域における地汚 れ、膜残り等が発生し難くなる。本発明におけるバイン ダーポリマーの使用量は、(A)着色剤100重量部に 対して、通常、10~1000重量部、好ましくは20 ~500重量部である。この場合、バインダーポリマー の使用量が10重量部未満では、例えば、アルカリ現像 性が低下したり、画素が形成される部分以外の領域での 地汚れや膜残りが発生するおそれがあり、一方1000 重量部を超えると、相対的に着色剤濃度が低下するた め、薄膜として目的とする色濃度を達成することが困難 となる場合がある。

## 【0014】(C)カルボキシル基含有多官能性モノマ

本発明におけるカルボキシル基含有多官能性モノマー は、重合可能なエチレン性不飽和結合を2個以上を有す るカルボキシル基含有モノマーからなる。このようなカ ルボキシル基含有多官能性モノマーとしては、例えば、 3価以上の多価アルコールと (メタ) アクリル酸との遊 離水酸基含有ポリ(メタ)アクリレート類と、ジカルボ ン酸類とのエステル化物;3価以上の多価カルボン酸 と、モノヒドロキシアルキル(メタ)アクリレート類と のエステル化物等を挙げることができる。カルボキシル 基含有多官能性モノマーの具体例としては、トリメチロ ールプロパンジアクリレート、トリメチロールプロパン ジメタクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレ ート、ペンタエリスリトールトリメタクリレート、ジペ ンタエリスリトールペンタアクリレート、ジペンタエリ スリトールペンタメタクリレート等のモノヒドロキシオ リゴアクリレートまたはモノヒドロキシオリゴメタクリ レート類と、マロン酸、こはく酸、グルタル酸、テレフ タル酸等のジカルボン酸類との遊離カルボキシル基含有 モノエステル化物;プロパン-1,2,3-トリカルボ ン酸(トリカルバリル酸)、ブタン-1,2,4-トリ カルボン酸、ベンゼン-1,2,3-トリカルボン酸、 ベンゼン-1,3,4-トリカルボン酸、ベンゼン-1,3,5-トリカルボン酸等のトリカルボン酸類と、 2-ヒドロキシエチルアクリレート、2-ヒドロキシエ チルメタクリレート、2ーヒドロキシプロピルアクリレ ート、2-ヒドロキシプロピルメタクリレート等のモノ ヒドロキシモノアクリレートまたはモノヒドロキシモノ メタクリレート類との遊離カルボキシル基含有オリゴエ ステル化物等を挙げることができる。これらのカルボキシル基含有多官能性モノマーのうち、特に、ペンタエリスリトールトリアクリレートとこはく酸との遊離カルボキシル基含有モノエステル化物(以下、「カルボキシル基含有多官能性モノマー(c1)」という。)、およびペンタエリスリトールトリメタクリレートとこはく酸との遊離カルボキシル基含有モノエステル化物(以下、

「カルボキシル基含有多官能性モノマー (c2)」という。)が好ましい。カルボキシル基含有多官能性モノマ10 ー (c1)は、下記式

【0016】で表される構造を有し、またカルボキシル 基含有多官能性モノマー (c2)は、下記式

【0017】 【化2】

$$\begin{array}{cccc} & & & & \text{CH}_3 \\ & & & \text{CH}_2 - 0\text{COC} = \text{CH}_2 \\ \text{CH}_2 = \text{CCOO} - \text{CH}_2 - \text{C} - \text{CH}_2 - 0\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{COOH} \\ & & \text{CH}_2 - 0\text{COC} = \text{CH}_2 \\ & & \text{CH}_2 - 0\text{COC} = \text{CH}_2 \\ & & \text{CH}_3 \end{array}$$

【0018】で表される構造を有するものであり、いずれも画素強度が高く、画素表面の平滑性に優れ、かつ画素が形成される部分以外の領域での地汚れや膜残りが発生し難い感放射線性組成物をもたらしうるものである。 【0019】前記カルボキシル基含有多官能性モノマー

【0019】 削記カルボキシル基含有多官能性モノマーは、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。本発明におけるカルボキシル基含有多官能性モノマーの使用量は、(B)バインダーポリマー100重量部に対して、通常、5~500重量部、好ましくは20~300重量部である。この場合、カルボキシル基含有多官能性モノマーの使用量が5重量部未満では、画素強度あるいは画素表面の平滑性が低下する傾向があり、一方500重量部を超えると、例えば、アルカリ現像性が低下したり、画素が形成される部分以外の領域での地汚れや膜残りが発生しやすくなる傾向がある。

【0020】また、本発明においては、所期の効果が損なわれない限り、前記カルボキシル基含有多官能性モノマーの一部を、他の多官能性モノマーおよび/または重合可能なエチレン性不飽和結合を1個有する単官能性モノマーに置き換えることもできる。前記他の多官能性モノマーとしては、例えば、エチレングリコール、プロピレングリコール等のアルキレングリコールのジアクリレートまたはジメタクリレート類:ポリエチレングリコー

ル、ポリプロピレングリコール等のポリアルキレングリ コールのジアクリレートまたはジメタクリレート類:グ リセリン、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリト ール、ジペンタエリスリトール等の3価以上の多価アル コールのオリゴアクリレートまたはオリゴメタクリレー ト類;ポリエステル、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、ア ルキド樹脂、シリコーン樹脂、スピラン樹脂等のオリゴ アクリレートまたはオリゴメタクリレート類; 両末端ヒ ドロキシポリブタジエン、両末端ヒドロキシポリイソプ レン、両末端ヒドロキシポリカプロラクトン等の両末端 ヒドロキシル化重合体のジアクリレートまたはジメタク リレート類や、トリスアクリロイルオキシエチルフォス フェート、トリスメタクリロイルオキシエチルフォスフ エート等を挙げることができる。これらの他の多官能性 モノマーは、単独でまたは2種以上を混合して使用する ことができる。他の多官能性モノマーの使用量は、カル ボキシル基含有多官能性モノマーとの合計100重量部 に対して、通常、0~200重量部であり、他の多官能 性モノマーを使用する際の好ましい使用割合は、カルボ キシル基含有多官能性モノマーとの合計100重量部に 対して、50~150重量部である。

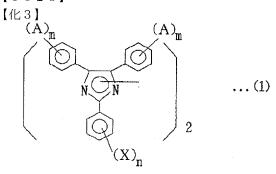
【0021】また、前記単官能性モノマーとしては、特 に限定されるものではなく、例えば、前記(B)バイン ダーポリマーにおける他の不飽和モノマーのほか、好ま しい単官能性モノマーとして、ωーカルボキシーポリカ プロラクトンモノアクリレート、ω-カルボキシーポリ カプロラクトンモノメタクリレート、2-アクリロイル オキシエチルこはく酸、2-メタクリロイルオキシエチ ルこはく酸、2-アクリロイルオキシプロピルこはく 酸、2-メタクリロイルオキシプロピルこはく酸、メト キシエチレングリコールアクリレート、メトキシエチレ ングリコールメタクリレート、メトキシジエチレングリ コールアクリレート、メトキシジエチレングリコールメ タクリレート、メトキシトリエチレングリコールアクリ レート、メトキシトリエチレングリコールメタクリレー ト、メトキシプロピレングリコールアクリレート、メト キシプロピレングリコールメタクリレート、メトキシジ プロピレングリコールアクリレート、メトキシジプロピ レングリコールメタクリレート、2-ヒドロキシー3-フェノキシプロピルアクリレート、2-ヒドロキシ-3 ーフェノキシプロピルメタクリレートや、市販品とし て、2-アクリロイロキシエチルこはく酸(商品名M-5300) 等を挙げることができる。これらの単官能性 モノマーは、単独でまたは2種以上を混合して使用する ことができる。単官能性モノマーの使用量は、カルボキ シル基含有多官能性モノマーおよび他の多官能性モノマ ーとの合計100重量部に対して、通常、0~90重量 部、好ましくは0~50重量部である。

# 【 O O 2 2 】 <u>(D) 光重合開始剤</u>

本発明における光重合開始剤は、光の照射により分解ま 50

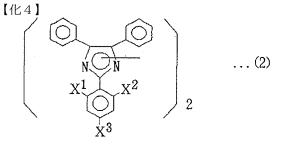
たは結合基が開裂して、ラジカル種、カチオン種、アニオン種等の前記(C)カルボキシル基含有多官能性モノマーの重合を開始しうる活性種を発生する化合物を意味する。このような光重合開始剤としては、ビイミダゾール環を有する化合物、ベンゾイン結合を有する化合物、他の光ラジカル発生剤、トリハロメチル基を有する化合物等を挙げることができる。前記ビイミダゾール環を有する化合物としては、下記一般式(1)で表される化合物(以下、「ビイミダゾール系化合物(1)」という。)、下記一般式(2)で表される化合物(以下、「ビイミダゾール系化合物(2)」という。)等を挙げることができる。

# [0023]



【0024】 [-般式(1) において、X は水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、炭素数  $1\sim4$  のアルキル基または炭素数  $6\sim9$  のアリール基を示し、A は一C (但し、R は炭素数  $1\sim4$  のアルキル基または炭素数  $6\sim9$  のアリール基を示す。)を示し、m は  $1\sim3$  の整数であり、n は  $1\sim3$  の整数である。〕

### [0025]



【0026】〔一般式(2)において、X'、 $X^2$  および $X^3$  は同一でも異なってもよく、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、炭素数 $1\sim4$ のアルキル基または炭素数 $6\sim9$ のアリール基を示す。但し、X'、 $X^2$  および $X^3$  の2個以上が同時に水素原子をとることはない。〕前記一般式(1)および一般式(2)は、2個のイミダゾール単位が1位または2位で相互に結合した構造を一般的に表している。したがって、ビイミダゾール系化合物(1)およびビイミダゾール系化合物(2)は、それらの主要骨格が下記式(3) $\sim$ (5)に相当する化合物の単独あるいは2種以上の混合物である。

### [0027]

[0028] 【化6】

[0029]

【化7】

【0030】一般式(1) および一般式(2) におい は、例えば、塩素原子、臭素原子、よう素原子等を挙げ ることができ、炭素数1~4のアルキル基としては、例 えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロ ピル基、n-ブチル基、i-ブチル基、sec-ブチル 基、t-ブチル基等を挙げることができ、炭素数6~9 のアリール基としては、例えば、フェニル基、oートリ ル基、mートリル基、pートリル基等を挙げることがで きる。また、一般式(1)において、Aで示される-CO 0-RにおけるRとしては、Xについて例示した炭素数1 ~4のアルキル基および炭素数6~9のアリール基を挙 げることができる。

【0031】ビイミダゾール系化合物(1)およびビイ ミダゾール系化合物(2)の具体例を示すと、次のとお りである。ビイミダゾール系化合物(1)としては、 5. 5' --- テトラキス (4-エトキシカルボニルフェ =1, =2, =1, (2-クロロフェニル) -4, 4', 5, 5' ーテトラ キス (4-フェノキシカルボニルフェニル) -1, 2' ービイミダゾール、2,2'ービス(2,4ージクロロ フェニル) -4, 4', 5, 5'-テトラキス (4-エ トキシカルボニルフェニル) -1, 2'ービイミダゾー 40 ル、2,2'ービス(2,4ージクロロフェニル)ー 4, 4', 5, 5'ーテトラキス(4ーフェノキシカル ボニルフェニル) -1, 2'ービイミダゾール、2,  $2' - \forall \lambda (2, 4, 6 - \lambda) = (2,$ 4', 5, 5'ーテトラキス(4ーエトキシカルボニル フェニル) -1, 2'-ビイミダゾール、2, 2'-ビ ス (2, 4, 6 -トリクロロフェニル) - 4, 4',5, 5'ーテトラキス(4ーフェノキシカルボニルフェ ニル) -1, 2'ービイミダゾール、2, 2'ービス

キス(4-エトキシカルボニルフェニル)-1,2'-ビイミダゾール、2,2'ービス(2-シアノフェニ ル) -4, 4', 5, 5'-テトラキス(4-フェノキ シカルボニルフェニル) -1, 2'-ビイミダゾール、 2, 2'-ビス(2-メチルフェニル)-4,4', 5, 5'ーテトラキス(4ーメトキシカルボニルフェニ (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)ーメチルフェニル) -4, 4', 5, 5'ーテトラキス (4-エトキシカルボニルフェニル)-1,2'-ビイ 10 ミダゾール、2,2'ービス(2-メチルフェニル)ー 4, 4', 5, 5'ーテトラキス(4ーフェノキシカル ボニルフェニル) -1, 2'-ビイミダゾール、2, 5'ーテトラキス(4ーメトキシカルボニルフェニル) -1, 2'-ビイミダゾール、2, 2'-ビス(2-エ チルフェニル) -4, 4', 5, 5'-テトラキス (4 ーエトキシカルボニルフェニル) -1, 2'ービイミダ ゾール、 $2, 2' - \forall \lambda (2 - x + x + y - x + y) - 4$ 4', 5, 5'ーテトラキス(4ーフェノキシカルボニ (1, 1, 2) (1, 2) (1, 2) (1, 2) (1, 2) (1, 2) (1, 2)ビス (2-フェニルフェニル) -4, 4', 5, 5'-テトラキス (4-メトキシカルボニルフェニル) -1, 2'ービイミダゾール、2,2'ービス(2-フェニル フェニル) -4, 4', 5, 5'-テトラキス (4-エ トキシカルボニルフェニル) -1, 2'ービイミダゾー ル、2, 2' ービス (2-フェニルフェニル) - 4, 4', 5, 5'ーテトラキス(4ーフェノキシカルボニ ルフェニル)-1,2'-ビイミダゾール等を挙げるこ とができる。

【0032】また、ビイミダゾール系化合物(2)とし ては、2,2'ービス(2,4ージクロロフェニル)ー 4, 4', 5, 5'ーテトラフェニルー1, 2'ービイ ミダゾール、2,2'ービス(2,4,6ートリクロロ フェニル) -4, 4', 5, 5'-テトラフェニルー 1, 2'ービイミダゾール、2, 2'ービス(2, 4-ジブロモフェニル) -4, 4', 5, 5'-テトラフェ ニルー1, 2'ービイミダゾール、2, 2'ービス (2, 4, 6-1) (2, 4, 6-1) (2, 4, 6)5'ーテトラフェニルー1, 2'ービイミダゾール、  $2, 2' - \forall \lambda (2, 4 - \forall \nu) + (2, 4 - \forall \nu) - 4,$ 4', 5, 5'ーテトラフェニルー1, 2'ービイミダ ゾール、2, 2'ービス(2, 4, 6ートリシアノフェ *ニル*) −4, 4', 5, 5' −テトラフェニル−1, 2'ービイミダゾール、2,2'ービス(2,4ージメ チルフェニル) -4, 4', 5, 5'-テトラフェニル -1, 2' -  $\forall$  1 = 14, 6ートリメチルフェニル) -4, 4', 5, 5'-テトラフェニルー1, 2'ービイミダゾール、2, 2' (2-シアノフェニル) -4, 4', 5. 5'-テトラ 50 5'-テトラフェニル-1, 2'-ビイミダゾール、

2, 2, -ビス (2, 4, 6-トリエチルフェニル) -4, 4, 5, 5, -テトラフェニル-1, 2, -ビイミダゾール、2, 2, -ビス (2, 4-ジフェニルフェニル) -4, 4, 5, 5, -テトラフェニル-1, 2, -ビイミダゾール、2, 2, -ビス (2, 4, 6-トリフェニルフェニル) -4, 4, 5, 5, -テトラフェニル-1, 2, -ビイミダゾール等を挙げることができる。

【0033】これらのうち、ビイミダゾール系化合物 (1) としては、特に、2,2'ービス(2ークロルフ エニル) -4, 4', 5, 5'-テトラキス (4-エト キシカルボニルフェニル)-1,2'-ビイミダゾール および2, 2'ービス(2ーブロモフェニル)ー4, 4', 5, 5'ーテトラキス(4ーエトキシカルボニル フェニル) -1, 2'ービイミダゾールが好ましく、ま たビイミダゾール系化合物(2)としては、特に、2, 2'ービス(2, 4ージクロロフェニル)ー4, 4' 5, 5'ーテトラフェニルー1, 2'ービイミダゾー ル、2,2'ービス(2,4ージブロモフェニル)ー 4, 4', 5, 5'ーテトラフェニルー1, 2'ービイ ミダゾール、2, 2'ービス(2, 4, 6ートリクロロ フェニル) -4, 4', 5, 5' -テトラフェニルー 1, 2'ービイミダゾールおよび2, 2'ービス(2, 4, 6-トリブロモフェニル) -4, 4', 5, 5'-テトラフェニルー1, 2'ービイミダゾールが好まし V1

【0034】ビイミダゾール系化合物(1)およびビイミダゾール系化合物(2)は、溶剤に対する溶解性に優れ、未溶解物、析出物等の異物を生じることがなく、しかも感度が高く、少ないエネルギー量の放射線照射によ30り硬化反応を十分進行させるとともに、コントラストが高く、放射線非照射部で硬化反応が生じることがないため、放射線照射後の塗膜は、現像液に対して不溶性の硬化部分と、現像液に対して高い溶解性を有する未硬化部分とに明確に区分され、パターンの欠落、欠損やアンダーカットのない優れたカラーフィルタを形成することができるものである。本発明において、ビイミダゾール系化合物(1)およびビイミダゾール系化合物(2)は、それぞれ単独でまたは2種以上を混合して使用することができ、またビイミダゾール系化合物(1)とビイミダゾール系化合物(2)とを併用することができる。

【0035】また、前記ベンゾイン結合を有する化合物および他の光ラジカル発生剤の具体例としては、2-ヒドロキシー2-メチルー1-フェニルプロパンー1-オン、1-(4-イソプロピルフェニル)-2-ヒドロキシー2-メチルプロパンー1-オン、4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニルー(2-ヒドロキシエトキシ)フェニルー(2-ヒドロキシンクロヘキシルフェニルケトン、2,2-ジメトキシ-2-フェニルアセトフェノン、2-メチルー(4-メチルチオフェニル)-2-

モルフォリノー1ープロパンー1ーオン、2ーベンジル -2-ジメチルアミノ-1-(4-モルフォリノフェニ ル) ブタン-1-オン、ベンゾフェノン、2, 4-ジェ チルチオキサントン、3,3-ジメチル-4-メトキシ ベンゾフェノン、4-アジドベンズアルデヒド、4-ア ジドアセトフェノン、4-アジドベンザルアセトフェノ ン、アジドピレン、4-ジアゾジフェニルアミン、4-ジアゾー4'ーメトキシジフェニルアミン、4ージアゾ -3-メトキシジフェニルアミン、ビス(2,6-ジメ トキシベンゾイル)-2,4,4-トリメチルペンチル フォスフィンオキサイド、ジベンゾイル、ベンゾインイ ソブチルエーテル、N-フェニルチオアクリドン、トリ フェニルピリリウムパークロレート等を挙げることがで きる。これらのベンゾイン結合を有する化合物および他 の光ラジカル発生剤は、単独でまたは2種以上を混合し て使用することができる。

14

【0036】また、前記トリハロメチル基を有する化合 物の具体例としては、1,3,5-トリス(トリクロロ メチル) - s - トリアジン、1, 3 - ビス(トリクロロ メチル) -5-(2'-クロロフェニル) -s-トリア ジン、1、3-ビス(トリクロロメチル)-5-(4) ークロロフェニル) - s - トリアジン、1,3-ビス (トリクロロメチル) -5-(2'-メトキシフェニ ル) - s - トリアジン、1, 3 - ビス(トリクロロメチ ル) -5-(4'-メトキシフェニル)-s-トリアジ ン等を挙げることができる。これらのトリハロメチル基 を有する化合物は、単独でまたは2種以上を混合して使 用することができる。前記ベンゾイン結合を有する化合 物、他の光ラジカル発生剤およびトリハロメチル基を有 する化合物のうち、2ーヒドロキシー2ーメチルー1ー フェニルプロパン-1-オン、2-メチル-(4-メチ ルチオフェニル)-2-モルフォリノ-1-プロパン-1-オン、2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-モルフォリノフェニル) ブタン-1-オン等が、 形成された画素パターンが現像時に基板から脱落し難 く、画素強度および感度も高い点で好ましい。本発明に おいて、ビイミダゾール環を有する化合物、ベンゾイン 結合を有する化合物、他の光ラジカル発生剤あるいはト リハロメチル基を有する化合物は、1種単独で、あるい は2種以上を組み合せて使用することができる。

【0037】本発明においては、必要に応じて、前記ビイミダゾール環を有する化合物、ベンゾイン結合を有する化合物、他の光ラジカル発生剤およびトリハロメチル基を有する化合物と共に、増感剤、硬化促進剤および高分子化合物からなる光架橋剤あるいは光増感剤(以下、「高分子光架橋・増感剤」という。)の群から選ばれる1種以上をさらに併用することもできる。前記増感剤の具体例としては、4,4'ービス(ジメチルアミノ)ベンゾフェノン、4,4'ービス(ジエチルアミノ)ベンブフェノン、4,4'ービス(ジエチルアミノ)ベンブフェノン、4ージエチルアミノアセトフェノン、4ー

ジメチルアミノプロピオフェノン、エチルー4ージメチ ルアミノベンゾエート、2-エチルヘキシル-1,4-ジメチルアミノベンゾエート、2.5-ビス(4)-ジ エチルアミノベンザル)シクロヘキサノン、7ージエチ ルアミノー3ー(4ージエチルアミノベンゾイル)クマ リン、4-(ジエチルアミノ)カルコン等を挙げること ができる。前記硬化促進剤の具体例としては、2-メル カプトベンゾイミダゾール、2-メルカプトベンゾチア ゾール、2-メルカプトベンゾオキサゾール、2,5-ジメルカプトー1,3,4-チアジアゾール、2-メル カプトー4,6-ジメチルアミノピリジン、1-フェニ ルー5-メルカプト-1H-テトラゾール、3-メルカ プトー4ーメチルー4H-1,2,4ートリアゾール等 の連鎖移動剤を挙げることができる。さらに、前記高分 子光架橋・増感剤は、光架橋剤および/または光増感剤 として機能しうる官能基を主鎖および/または側鎖中に 有する高分子化合物であり、その具体例としては、4-アジドベンズアルデヒドとポリビニルアルコールとの縮 合物、4-アジドベンズアルデヒドとフェノールノボラ ック樹脂との縮合物、4-アクリロイルフェニルシンナ モイルエステルの単独重合体あるいは共重合体、1,4 ーポリブタジエン、1,2-ポリブタジエン等を挙げる ことができる。前記増感剤、硬化促進剤および高分子光 架橋・増感剤のうち、4,4'ービス(ジメチルアミ ノ) ベンゾフェノン、4,4'ービス(ジエチルアミ ノ)ベンゾフェノン、2-メルカプトベンゾチアゾール 等が、形成された画素パターンが現像時に基板から脱落 し難く、画素強度および感度も高い点で好ましい。

【0038】本発明においては、光重合開始剤として、 ビイミダゾール系化合物(1)およびビイミダゾール系 化合物(2)の群から選ばれる1種以上と、ベンゾフェ ノン系のベンゾイン結合を有する化合物、ベンゾフェノ ン系の他の光ラジカル発生剤、ベンゾフェノン系の増感 剤およびチアゾール系の硬化促進剤の群から選ばれる1 種以上とを組み合わせて使用することが特に好ましい。 前記特に好ましい組み合わせの具体例としては、2. 5'ーテトラキス(4ーエトキシカルボニルフェニル) ビイミダゾール/4,4'ービス(ジエチルアミノ)ベ ンゾフェノン、2,2'ービス(2-クロロフェニル) -4, 4', 5, 5'-テトラキス (4-エトキシカル ボニルフェニル) ビイミダゾール/4,4'ービス(ジ エチルアミノ) ベンゾフェノン/2-ベンジル-2-ジ メチルアミノー1ー(4ーモルフォリノフェニル)ブタ -4, 4', 5, 5'-テトラキス (4-エトキシカル ボニルフェニル) ビイミダゾール/4,4'ービス(ジ エチルアミノ) ベンゾフェノン/1-ヒドロキシシクロ ヘキシルフェニルケトン、2,2'ービス(2-クロロ フェニル) -4, 4', 5, 5'-テトラキス (4-エ 16

トキシカルボニルフェニル) ビイミダゾール/4,4' ービス(ジメチルアミノ)ベンゾフェノン/1ーヒドロ キシシクロヘキシルフェニルケトン/2-メルカプトベ ンゾチアゾール、2, 2'ービス(2, 4ージクロロフ エニル) -4, 4', 5, 5' -テトラフェニルビイミ ダゾール/4,4'ービス(ジエチルアミノ)ベンゾフ ェノン、2,2'ービス(2,4ージブロモフェニル) -4,4',5,5'-テトラフェニルビイミダゾール /4,4'ービス(ジエチルアミノ)ベンゾフェノン/ 2-ベンジルー2-ジメチルアミノー1-(4-モルフ オリノフェニル) ブタンー1ーオン、2,2'ービス (2, 4-ジブロモフェニル) -4, 4', 5, 5'-テトラフェニルビイミダゾール/4,4'ービス(ジエ チルアミノ)ベンゾフェノン/1-ヒドロキシシクロへ キシルフェニルケトン、および2,2'ービス(2, 4. 6ートリクロロフェニル) -4, 4', 5, 5'-テトラフェニルビイミダゾール/4, 4'ービス(ジメ チルアミノ)ベンゾフェノン/1-ヒドロキシシクロへ キシルフェニルケトン/2-メルカプトベンゾチアゾー ルを挙げることができる。

化合物、他の光ラジカル発生剤およびトリハロメチル基 を有する化合物の合計使用割合は、光重合開始剤全体の 80重量%以下であることが好ましく、また増感剤およ び硬化促進剤の合計使用割合は、光重合開始剤全体の8 0重量%以下であることが好ましく、さらに高分子光架 橋・増感剤の使用割合は、ビイミダゾール系化合物 (1)およびビイミダゾール系化合物(2)の合計10 0重量部に対して、通常、200重量部以下、好ましく は0.01~200重量部、さらに好ましくは50~1 80重量部である。本発明における光重合開始剤の合計 使用割合は、(C)カルボキシル基含有多官能性モノマ 一100重量部に対して、通常、0.01~200重量 部、好ましくは1~120重量部、特に好ましくは1~ 50重量部である。この場合、光重合開始剤の合計使用 割合が0.01重量部未満では、放射線照射による硬化 が不十分となり、画素パターンに欠落、欠損やアンダー カットを生じるおそれがあり、一方200重量部を超え ると、形成された画素パターンが現像時に基板から脱落 しやすく、また画素パターンが形成される部分以外の領

【0039】本発明において、ベンゾイン結合を有する

#### 【0040】添加剤

さらに、本発明のカラーフィルタ用感放射線性組成物 は、必要に応じて種々の添加剤を含有することもでき る。このような添加剤としては、例えば、ガラス、アル ミナ等の充填剤;ポリビニルアルコール、ポリエチレン グリコールモノアルキルエーテル類、ポリ(フロロアル キルアクリレート) 類等の高分子化合物; ノニオン系界 面活性剤、カチオン系界面活性剤、アニオン系界面活性 剤等の界面活性剤;ビニルトリメトキシシラン、ビニル

域で地汚れ、膜残り等を生じやすくなる。

18

トリエトキシシラン、ビニルトリス (2-メトキシエト キシ)シラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノ プロピルメチルジメトキシシラン、N-(2-アミノエ チル) -3-アミノプロピルトリメトキシシラン、3-アミノプロピルトリエトキシシラン、3-グリシドキシ プロピルトリメトキシシラン、3-グリシドキシプロピ ルメチルジメトキシシラン、2-(3,4-エポキシシ クロヘキシル) エチルトリメトキシシラン、3-クロロ プロピルメチルジメトキシシラン、3-クロロプロピル トリメトキシシラン、3-メタクリロキシプロピルトリ メトキシシラン、3-メルカプトプロピルトリメトキシ シラン等の密着促進剤;2,2-チオビス(4-メチル -6-t-ブチルフェノール)、2, 6-ジーt-ブチ ルフェノール等の酸化防止剤;2-(3-t-ブチルー 5-メチル-2-ヒドロキシフェニル) -5-クロロベ ンゾトリアゾール、アルコキシベンゾフェノン類等の紫 外線吸収剤;ポリアクリル酸ナトリウム等の凝集防止剤 等を挙げることができる。

## 【0041】溶剤

本発明のカラーフィルタ用感放射線性組成物は、前記 (A) 成分、(B) 成分、(C) 成分および(D) 成分 を必須成分とし、必要に応じて前記添加剤成分を含有す るが、通常、(A)成分以外の成分を適当な溶剤に溶解 した液状組成物として調製される。前記溶剤としては、 (A)成分、(B)成分、(C)成分および(D)成分 や添加剤成分を溶解または分散し、かつこれらの成分と 反応せず、適度の揮発性を有するものである限り、適宜 に選択して使用することができる。このような溶剤とし ては、例えば、エチレングリコールモノメチルエーテ ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレ ングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコー ルモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノーn -プロピルエーテル、ジエチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエ ーテル、トリエチレングリコールモノエチルエーテル、 プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレン グリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコー ルモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエ チルエーテル、ジプロピレングリコールモノ-n-プロ ピルエーテル、ジプロピレングリコールモノーnーブチ 40 ルエーテル、トリプロピレングリコールモノメチルエー テル、トリプロピレングリコールモノエチルエーテル等 の(ポリ)アルキレングリコールモノアルキルエーテル 類;エチレングリコールモノメチルエーテルアセテー ト、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテー ト、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテー ト、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテー ト等の(ポリ)アルキレングリコールモノアルキルエー テルアセテート類;ジエチレングリコールジメチルエー テル、ジエチレングリコールメチルエチルエーテル、ジ 50

エチレングリコールジエチルエーテル、テトラヒドロフ ラン等の他のエーテル類:メチルエチルケトン、シクロ ヘキサノン、2-ヘプタノン、3-ヘプタノン等のケト ン類:2-ヒドロキシプロピオン酸メチル、2-ヒドロ キシプロピオン酸エチル等の乳酸アルキルエステル類; 2-ヒドロキシー2-メチルプロピオン酸メチル、2-ヒドロキシー2-メチルプロピオン酸エチル、3-メト キシプロピオン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸エ チル、3-エトキシプロピオン酸メチル、3-エトキシ プロピオン酸エチル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ 酢酸エチル、2-ヒドロキシ-3-メチルブタン酸メチ ル、3-メチル-3-メトキシブチルアセテート、3-メチルー3ーメトキシブチルプロピオネート、酢酸エチ ル、酢酸n-ブチル、酢酸n-プロピル、酢酸イソプロ ピル、酢酸n-ブチル、酢酸イソブチル、酢酸n-アミ ル、酢酸イソアミル、プロピオン酸nーブチル、酪酸エ チル、酪酸n-プロピル、酪酸イソプロピル、酪酸n-ブチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、ピルビ ン酸nープロピル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチ ル、2-オキソブタン酸エチル等の他のエステル類:ト ルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類:Nーメチルピ ロリドン、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージ メチルアセトアミド等のカルボン酸アミド類等を挙げる ことができる。これらの溶剤は、単独でまたは2種以上 を混合して使用することができる。さらに、前記溶剤と 共に、ベンジルエチルエーテル、ジヘキシルエーテル、 アセトニルアセトン、イソホロン、カプロン酸、カプリ ル酸、1-オクタノール、1-ノナノール、ベンジルア ルコール、酢酸ベンジル、安息香酸エチル、しゅう酸ジ エチル、マレイン酸ジエチル、γーブチロラクトン、炭 酸エチレン、炭酸プロピレン、エチレングリコールモノ フェニルエーテルアセテート等の高沸点溶剤を併用する こともできる。これらの高沸点溶剤は、単独でまたは2 種以上を混合して使用することができる。前記溶剤のう ち、溶解性、顔料分散性、塗布性等の観点から、エチレ ングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレ ングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレ ングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレ ングリコールジメチルエーテル、シクロヘキサノン、2 ーヘプタノン、3ーヘプタノン、2ーヒドロキシプロピ オン酸エチル、3-メチル-3-メトキシブチルプロピ オネート、3-メトキシプロピオン酸エチル、3-エト キシプロピオン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エ チル、酢酸n-ブチル、酢酸イソブチル、酢酸n-アミ ル、酢酸イソアミル、プロピオン酸nーブチル、酪酸エ チル、酪酸イソプロピル、酪酸n-ブチル、ピルビン酸 エチル等が好ましく、また高沸点溶剤としてはソーブチ ロラクトン等が好ましい。本発明における溶剤の使用割 合は、(B)バインダーポリマー100重量部に対し て、通常、100~10000重量部、好ましくは50

0~5000重量部である。

# 【0042】<u>カラーフィルタの形成方法</u>

次に、本発明のカラーフィルタ用感放射線性組成物を用 いて、カラーフィルタを形成する方法について説明す る。まず、透明基板の表面上の画素を形成する部分を区 画するように遮光層を形成し、この基板上に、例えば赤 色の顔料が分散された感放射線性組成物の液状組成物を 塗布したのち、プリベークを行って溶剤を蒸発させ、塗 膜を形成する。次いで、この塗膜にフォトマスクを介し て放射線を照射したのち、アルカリ現像液を用いて現像 処理を行い、塗膜の放射線非照射部を溶解除去すること によって、赤色の画素が所定のパターンで配置された画 素アレイを形成する。その後、緑色または青色の顔料が 分散された各感放射線性組成物の液状組成物を用い、前 記と同様にして、各液状組成物の塗布、プリベーク、放 射線照射および現像処理を行って、緑色の画素アレイお よび青色の画素アレイを同一基板上に順次形成すること により、赤色、緑色および青色の三原色の画素アレイが 基板上に配置されたカラーフィルタを得る。カラーフィ ルタを形成する際に使用される透明基板としては、例え ば、ガラス、シリコン、ポリカーボネート、ポリエステ ル、芳香族ポリアミド、ポリアミドイミド、ポリイミド 等を挙げることができる。これらの透明基板には、所望 により、シランカップリング剤等による薬品処理、プラ ズマ処理、イオンプレーティング、スパッタリング、気 相反応法、真空蒸着等の適宜の前処理を施しておくこと もできる。感放射線性組成物の液状組成物を透明基板に 塗布する際には、回転塗布、流延塗布、ロール塗布等の 適宜の塗布法を採用することができる。塗布厚さは、乾 燥後の膜厚として、通常、 $0.1 \sim 10 \mu m$ 、好ましく は $0.2\sim5.0\mu$ m、特に好ましくは $0.2\sim3.0$  $\mu$  mである。カラーフィルタを形成する際に使用される 放射線としては、例えば、可視光線、紫外線、遠紫外 線、電子線、X線等を使用することができるが、波長が 190~450nmの範囲にある放射線が好ましい。放 射線の照射エネルギー量は、好ましくは1~1000m J/cm<sup>®</sup>である。また、前記アルカリ現像液として は、例えば、炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、水酸 化カリウム、テトラメチルアンモニウムハイドロオキサ イド、コリン、1,8-ジアザビシクロー[5.4. 0] -7-ウンデセン、1,5-ジアザビシクロー [4.3.0] -5-ノネン等の水溶液が好ましい。前 記アルカリ現像液には、例えばメタノール、エタノール 等の水溶性有機溶剤や界面活性剤等を適量添加すること もできる。なお、アルカリ現像後は、通常、水洗する。 現像処理法としては、シャワー現像法、スプレー現像 法、ディップ(浸漬)現像法、パドル(液盛り)現像法 等を適用することができ、現像条件は、常温で5~30 0秒が好ましい。このようにして形成されたカラーフィ ルタは、例えば、カラー液晶表示装置、カラー撮像管素

子、カラーセンサー等に極めて有用である。

#### [0043]

【発明の実施の形態】本発明のカラーフィルタ用感放射線性組成物は、(A)着色剤、(B)バインダーポリマー、(C)カルボキシル基含有多官能性モノマーおよび(D)光重合開始剤を必須成分として含有するものであるが、特に好ましい組成物を具体的に例示すると、下記(イ)~(へ)のとおりである。

- (イ) (B) 成分がカルボキシル基含有共重合体
- (b) からなり、(D) 成分が 2, 2'-ビス (2-クロルフェニル) -4, 4', 5, 5'-テトラキス (4-エトキシカルボニルフェニル) -1, 2'-ビイミダゾールおよび 2, 2'-ビス (2-ブロモフェニル) -4, 4', 5, 5'-テトラキス (4-エトキシカルボニルフェニル) -1, 2'-ビイミダゾールの群から選ばれる 1種以上のビイミダゾール系化合物(1)を含有するカラーフィルタ用感放射線性組成物。
- (ロ) (B) 成分がカルボキシル基含有共重合体
- (b) からなり、(D) 成分が2, 2'ービス(2, 4 ージクロロフェニル) ー4, 4', 5、5'ーテトラフェニルー1, 2'ービイミダゾール、2, 2'ービス(2, 4ージブロモフェニル) ー4, 4', 5, 5'ーテトラフェニルー1, 2'ービイミダゾール、2, 2'ービス(2, 4, 6ートリクロロフェニル) ー4, 4', 5, 5'ーテトラフェニルー1, 2'ービイミダゾールおよび2, 2'ービス(2, 4, 6ートリプロモフェニル) ー4, 4', 5, 5'ーテトラフェニルー1, 2'ービイミダゾールの群から選ばれる1種以上のビイミダゾール系化合物(2)を含有するカラーフィルタ用感放射線性組成物。
- (ハ) (D) 成分がさらに、ベンゾイン結合を有する化合物、ベンゾフェノン系の他の光ラジカル発生剤、ベンゾフェノン系の増感剤およびチアゾール系の硬化促進剤の群から選ばれる1種以上を含む前記(イ)または(ロ)のカラーフィルタ用感放射線性組成物。
- (二) (B) 成分であるカルボキシル基含有共重合体(b) が、メタクリル酸/ベンジルメタクリレート共重合体、メタクリル酸/ベンジルメタクリレート/スチレン共重合体、メタクリル酸/メチルメタクリレート/スチレン共重合体、メタクリル酸/メチルメタクリレート/ポリスチレンマクロモノマー共重合体、メタクリル酸/ベンジルメタクリレート/ポリメチルメタクリレート/ポリスチレンマクロモノマー共重合体、メタクリル酸/メチルメタクリレート/ポリスチレンマクロモノマー共重合体、メタクリル酸/メチルメタクリレート/ボリスチレンマクロモノマー共重合体およびメタクリル酸/2ーヒドロキシエチルメタクリレート/ベンジルメタクリレート/ボリスチレンマクロモノマー共重合体およびメタクリル酸/2ーヒドロキシエチルメタクリレート/ベンジルメタクリレート/ベンジルメタクリレート/ベンジルメタクリレート/ベン

モノマー共重合体の群から選ばれる少なくとも1種の共 重合体である前記(イ)、(ロ)または(ハ)のカラー フィルタ用感放射線性組成物。

(ホ) (C) 成分がカルボキシル基含有多官能性モノマー(c1) およびカルボキシル基含有多官能性モノマー(c2) の群から選ばれる少なくとも1種である前記(イ)、(ロ)、(ハ) または(ニ) のカラーフィルタ用感放射線性組成物。

(へ) (A) 成分が有機顔料および/またはカーボンブラックである前記(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)ま 10たは(ホ)のカラーフィルタ用感放射線性組成物。

【0044】以下、実施例を挙げて、本発明の実施の形態をさらに具体的に説明する。但し、本発明は、これらの実施例に何ら制約されるものではない。

# 比較例1

(A) 成分としてカーボンブラック100重量部、

(B)成分としてメタクリル酸/ベンジルメタクリレー ト/2-ヒドロキシエチルメタクリレート/ポリスチレ ンマクロモノマー共重合体(共重合重量比=60/15 /15/10、重量平均分子量=25,000)50重 20 量部、(C)成分としてジペンタエリスリトールペンタ アクリレート40重量部、(D) 成分として2, 2'-ビス(2,4-ジクロロフェニル)-4,4',5、 5'ーテトラフェニルー1,2'ービイミダゾール10 重量部と2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4 ーモルフォリノフェニル)ブタン-1-オン30重量部 と4,4'ービス(ジエチルアミノ)ベンゾフェノン1 0重量部と2-メルカプトベンゾチアゾール5重量部、 および溶剤として3-エトキシプロピオン酸エチル15 00重量部を混合して液状組成物を調製した。次いで、 表面にナトリウムイオンの溶出を防止するシリカ(Si0<sub>2</sub>) 膜が形成されたソーダガラス製透明基板の表面上に、画 素を形成する部分を区画するように遮光層を設けたの ち、スピンコーターを用いて前記液状組成物を塗布し、 90℃で4分間プリベークを行なって、膜厚1.3μm の塗膜を形成した。その後、基板を室温まで冷却したの ち、高圧水銀ランプを用い、フォトマスクを介して、塗 膜に波長365mmの紫外線を200mJ/cm 照射 した。次いで、基板を23℃の0.04重量%水酸化カ リウム水溶液中に1分間浸漬して現像処理を行い、超純 40 水で洗浄し、風乾したのち、さらに270℃で30分間 ポストベークを行なって、基板上に線幅20μmの黒色\*

\*パターンが形成されたブラックマトリックスを作製した。このブラックマトリックスは、線幅が設計寸法の110~120%で、パターンの欠落や破損が認められた。また、このブラックマトリックスについて、粘着テープによる剥離試験を行ったところ、パターンの剥がれが生じた。しかも、放射線非照射部に組成物の未溶解物(残渣)が残存し、パターン上にはスカムが認められた。

# [0045]

# 10 【実施例】

#### 実施例1

- (A) 成分としてカーボンブラック100重量部、
- (B) 成分としてメタクリル酸/ベンジルメタクリレー ト/2-ヒドロキシエチルメタクリレート/ポリスチレ ンマクロモノマー共重合体(共重合重量比=60/15 /15/10、重量平均分子量=25,000)50重 量部、(C)成分としてカルボキシル基含有多官能性モ ノマー(c1)30重量部とジペンタエリスリトールペ ンタアクリレート40重量部、(D) 成分として2, 2'ービス(2, 4ージクロロフェニル)-4, 4', 5、5'ーテトラフェニルー1, 2'ービイミダゾール 10重量部と2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-モルフォリノフェニル) ブタン-1-オン30重 量部と4,4'ービス(ジエチルアミノ)ベンゾフェノ ン10重量部と2-メルカプトベンゾチアゾール5重量 部、および溶剤として3-エトキシプロピオン酸エチル 1500重量部を混合して液状組成物を調製した。この 液状組成物を用い、比較例1と同様にして、ブラックマ トリックスを作製した。このブラックマトリックスは、 線幅が20μmで設計寸法のとおりであり、パターンの 欠落や破損が認められなかった。また、このブラックマ トリックスについて、粘着テープによる剥離試験を行っ たところ、パターンの剥がれを生じなかった。しかも、 放射線非照射部に組成物の未溶解物(残渣)が残存した り、パターン上にスカムが発生することがなかった。

# [0046]

【発明の効果】本発明のカラーフィルタ用感放射線性組成物は、微細な画素アレイを形成する場合であっても、放射線非照射部に組成物の未溶解物(残渣)が残存したり、画素上にスカムが発生することがなく、しかも高精度でかつ基板との密着強度に優れた画素アレイを高い歩留りで形成することができる。

フロントページの続き

(72)発明者 熊野 厚司

東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社内

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成14年8月9日(2002.8.9)

【公開番号】特開平10-332929

【公開日】平成10年12月18日(1998.12.18)

【年通号数】公開特許公報10-3330

505

【出願番号】特願平9-153134

### 【国際特許分類第7版】

G02B 5/20 101 C09D 5/00 G03F 7/004 505 7/033 [FI] G02B 5/20 101 C09D 5/00

7/004

7/033

### 【手続補正書】

G03F

【提出日】平成14年5月29日(2002.5.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 着色剤、(B) バインダーポリマー、(C) カルボキシル基含有多官能性モノマーおよび(D) 光重合開始剤を含有することを特徴とするカラーフィルタ用感放射線性組成物。

【請求項2】 (B)成分がメタクリル酸/ベンジルメ タクリレート共重合体、メタクリル酸/ベンジルメタク リレート/スチレン共重合体、メタクリル酸/メチルメ タクリレート/スチレン共重合体、メタクリル酸/ベン ジルメタクリレート/ポリスチレンマクロモノマー共重 <u>合体、メタクリル酸/ベンジルメタクリレート/ポリメ</u> チルメタクリレートマクロモノマー共重合体、メタクリ ル酸/メチルメタクリレート/ポリスチレンマクロモノ マー共重合体、メタクリル酸/メチルメタクリレート/ ポリメチルメタクリレートマクロモノマー共重合体、メ タクリル酸/2-ヒドロキシエチルメタクリレート/ベ ンジルメタクリレート/ポリスチレンマクロモノマー共 重合体およびメタクリル酸/2-ヒドロキシエチルメタ クリレート/ベンジルメタクリレート/ポリメチルメタ クリレートマクロモノマー共重合体の群から選ばれる少 なくとも1種の共重合体からなり、(D)成分が2、  $2' - \forall \lambda (2 - \beta \mu \nu \nu \nu \nu \nu \nu) - 4, 4', 5,$ 5'-テトラキス(4-エトキシカルボニルフェニル)

-1, 2'-ビイミダゾールおよび2, 2'-ビス(2 -ブロモフェニル) -4, 4', 5, 5'-テトラキス (4-エトキシカルボニルフェニル) -1, 2'-ビイ ミダゾールの群から選ばれる1種以上のビイミダゾール 系化合物を含有する請求項1に記載のカラーフィルタ用 感放射線性組成物。

【請求項3】 (B) 成分がメタクリル酸/ベンジルメ タクリレート共重合体、メタクリル酸/ベンジルメタク リレート/スチレン共重合体、メタクリル酸/メチルメ タクリレート/スチレン共重合体、メタクリル酸/ベン ジルメタクリレート/ポリスチレンマクロモノマー共重 <u>合体、メタクリル酸/ベンジルメタクリレート/ポリメ</u> チルメタクリレートマクロモノマー共重合体、メタクリ ル酸/メチルメタクリレート/ポリスチレンマクロモノ マー共重合体、メタクリル酸/メチルメタクリレート/ ポリメチルメタクリレートマクロモノマー共重合体、メ タクリル酸/2-ヒドロキシエチルメタクリレート/ベ ンジルメタクリレート/ポリスチレンマクロモノマー共 重合体およびメタクリル酸/2-ヒドロキシエチルメタ クリレート/ベンジルメタクリレート/ポリメチルメタ クリレートマクロモノマー共重合体の群から選ばれる少 なくとも1種の共重合体からなり、(D)成分が2,  $2' - \forall \lambda (2, 4 - \forall \lambda ) - \lambda (2, 4')$ <u>4, 4', 5, 5'ーテトラフェニルー1, 2'ービイ</u> <u>フェニル) - 4, 4', 5, 5' - テトラフェニルー</u> 1, 2'-ビイミダゾールおよび2, 2'-ビス(2. 4,6-トリブロモフェニル)-4,4',5,5'-

<u>テトラフェニルー1, 2'ービイミダゾールの群から選ばれる1種以上のビイミダゾール系化合物を含有するカラーフィル</u>タ用感放射線性組成物。

【請求項4】 (D) 成分がさらに、ベンゾイン結合を有する化合物、ベンゾフェノン系の他の光ラジカル発生剤、ベンゾフェノン系の増感剤およびチアゾール系の硬化促進剤の群から選ばれる1種以上を含む請求項2または請求項3に記載のカラーフィルタ用感放射線性組成物。

<u>【請求項5</u> (C) 成分が下記式 【化1】

$$\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{OCOCH} = \text{CH}_2 \\ \text{CH}_2 = \text{CHCOO} - \text{CH}_2 - \overset{\circ}{\text{C}} - \text{CH}_2 - \text{OCOCH}_2 \text{CH}_2 \text{COOH} \\ \overset{\circ}{\text{CH}_2} - \text{OCOCH} = \text{CH}_2 \end{array}$$

で表されるカルボキシル基含有多官能性モノマーおよび 下記式

【化2】

$$\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{2} - \text{OCOC} = \text{CH}_{2} \\ \text{CH}_{2} = \text{CCOO} - \text{CH}_{2} - \text{C} - \text{CH}_{2} - \text{OCOCH}_{2} \text{CH}_{2} \text{COOH} \\ \text{CH}_{2} - \text{OCOC} = \text{CH}_{2} \\ \text{CH}_{3} \end{array}$$

で表されるカルボキシル基含有多官能性モノマーの群から選ばれる少なくとも1種である請求項1~4の何れかに記載のカラーフィルタ用感放射線性組成物。

【請求項6】 (A) 成分が有機顔料および/またはカ ーボンブラックである請求項1~5の何れかに記載のカ ラーフィルタ用感放射線性組成物。 【請求項7】 請求項1~6の何れかに記載のカラーフィルタ用感放射線性組成物から形成してなる画素を有するカラーフィルタ。

【請求項8】 請求項7に記載のカラーフィルタを具備 するカラー液晶表示装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正内容】

[0015]

【化1】

$$\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{OCOCH}=\text{CH}_2\\ \text{CH}_2-\text{CHCOO}-\text{CH}_2-\overset{\text{I}}{\text{C}}-\text{CH}_2-\text{OCOCH}_2\text{CH}_2\text{COOH}\\ \text{CH}_2-\text{OCOCH}=\text{CH}_2 \end{array}$$

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 1 7

【補正方法】変更

【補正内容】

[0017]

【化2】

$$\begin{array}{c} \text{CH}_{3} & \text{CH}_{2} - \text{OCOC} = \text{CH}_{2} \\ \text{CH}_{2} = \text{CCOO} - \text{CH}_{2} - \text{C} - \text{CH}_{2} - \text{OCOCH}_{2} \text{CH}_{2} \text{COOH} \\ \text{CH}_{2} - \text{OCOC} = \text{CH}_{2} \\ \text{CH}_{3} & \text{CH}_{3} \end{array}$$